

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年2月16日(16.02.2023)



(10) 国際公開番号

WO 2023/017620 A1

(51) 国際特許分類:
H05K 3/34 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2021/029839

(22) 国際出願日: 2021年8月13日(13.08.2021)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(71) 出願人: 株式会社新川 (**SHINKAWA LTD.**) [JP/
JP]; 〒2088585 東京都武蔵村山市伊奈平 2
丁目 5 1 番地の 1 Tokyo (JP).

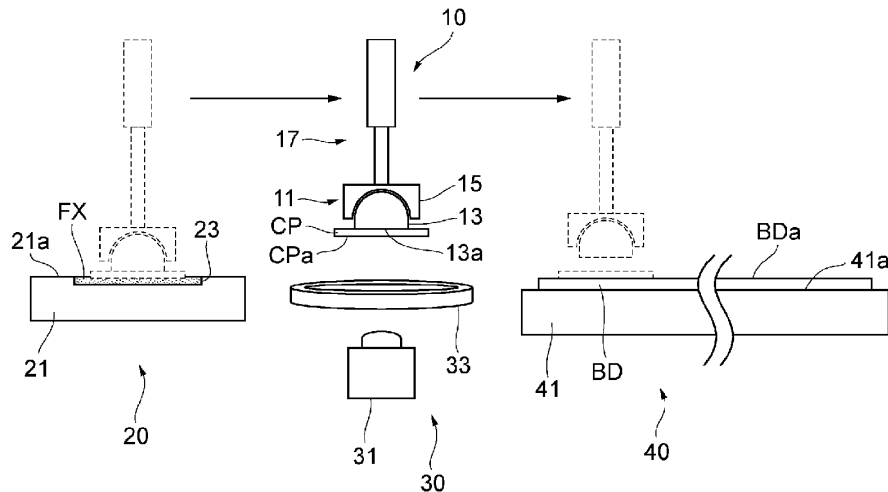
(72) 発明者: 吉田 信一 (**YOSHIDA, Shinichi**);
〒2088585 東京都武蔵村山市伊奈平 2 丁目 5 1
番地の 1 株式会社新川内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 稲葉 良幸, 外 (**INABA, Yoshiyuki et al.**);
〒1066123 東京都港区六本木 6 - 1 0 -
1 六本木ヒルズ森タワー 2 3 階 T M I
総合法律事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL,

(54) **Title:** FLUX TRANSFER DEVICE, FLUX TRANSFER METHOD AND MOUNTING DEVICE

(54) 発明の名称: フラックス転写装置、フラックス転写方法及び実装装置



(57) **Abstract:** This flux transfer device (1) is provided with: a transfer stage (21) which stores flux; a holding tool (13) which holds an electronic component (CP) on a holding surface (13a) so that an electrode forming surface (CPa) of the electronic component (CP) is immersed in the flux stored on the transfer stage (21); an imaging unit (31) which acquires the captured image of at least one of the electrode forming surface (CPa) of the electronic component (CP) after flux transfer and the transfer stage (21) after the flux transfer; and a detection unit (51) which detects the inclination of the holding surface (13a) relative to the transfer stage (21) on the basis of the captured image.

[続葉有]

ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告(条約第21条(3))

(57) 要約: フラックス転写装置(1)は、フラックスを貯留する転写ステージ(21)と、電子部品(CP)の電極形成面(CPA)を転写ステージ(21)に貯留されたフラックスに浸漬するように電子部品(CP)を保持面(13a)で保持する保持ツール(13)と、フラックス転写後の電子部品(CP)の電極形成面(CPA)、及び、フラックス転写後の転写ステージ(21)のうち、少なくとも一方の撮像画像を取得する撮像部(31)と、撮像画像に基づいて、転写ステージ(21)に対する保持面(13a)の傾きを検出する検出部(51)と、を備える。